

E DIN 50453-2:2023-02 (D)

Erscheinungsdatum: 2023-01-06

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens	4
5 Geräte.....	4
6 Silicium-Substrat	5
7 Zusammensetzung der Ätzmischungen	5
8 Einflüsse auf das Messergebnis	5
8.1 Struktur der Siliciumdioxidschicht	5
8.2 Temperatur	5
8.3 Dotierung.....	5
9 Probenvorbereitung.....	5
10 Durchführung.....	5
11 Auswertung	7
12 Präzision des Verfahrens.....	7
13 Prüfbericht	8

Bilder

Bild 1 — Versuchsaufbau zur Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen aus E DIN 50453-1:2023-02	6
--	---